Si 直接ドーピング InAs/GaAs 量子ドットのキャリア緩和過程

Carrier relaxation process in Si-direct doped InAs/GaAs quantum dots 神戸大院工, ^o長谷川 隆一, 原田 幸弘, 喜多 隆 Kobe University, [°]R. Hasegawa, Y. Harada, and T. Kita E-mail: r-hasegawa@stu.kobe-u.ac.jp

【はじめに】自己形成 InAs/GaAs 量子ドット(QD)はその3次元的な量子閉じ込めによってできるデル タ関数的な電子状態(励起子状態)によって、クーラーレス直接変調レーザー、偏波無依存超高速光 中継デバイス、また最近では高変換効率中間バンド型太陽電池などを実現することが期待されている。 この様な量子ドットを利用した光デバイスではドット中のキャリア数がデバイス特性に大きく影響し、 精密なキャリア制御が不可欠である。われわれは量子ドットへの精密な不純物ドーピングを実現する ため、InAs/GaAs 量子ドットの自己形成過程を巧みに利用した不純物の直接ドーピング技術を開発し た[1]。直接ドーピングは InAs 自己形成過程で不純物を選択的に供給することで量子ドット中に効果 的に不純物をとり込む技術である。これまでの研究で、Si を直接ドーピングした InAs 量子ドットに おいて、余剰電子による電子捕獲欠陥の補償効果を明らかにするとともに、発光特性の向上を確認し た[2,3]。本研究では、量子ドットあたり1個をこえる Si を添加したときの光励起キャリアのエネルギ ー緩和過程を明らかにするため、時間分解フォトルミネッセンス (PL) 測定法を用い詳細に評価した。

【実験と結果】MBEにより、アンドープ GaAs(001)基板に InAs QD を成長した。Si ドープした試料 (Si-doped QDs) とドープしない試料 (undoped QDs) を作製した。Si ドーピングは QD 成長中の Assembling step [1] で選択的に行い、Si 面密度は 4.5×10^{10} cm⁻² (QD 1個当たり約3個) とした。InAs 供給量は 2.1 原子層である。測定は、励起光源にはパルス幅 130 fs、繰り返し周波数 80 MHz の Ti:sapphire パルスレーザー、検出には時間分解能 16 ps の近赤外ストリークカメラを用い、励起光エ ネルギー 1.55 eV、励起光強度 0.05 mW とした。まず、3~290 K における PL 測定より得た半値幅を 図1 (a)に、Si-doped QDs と undoped QDs の PL ピークエネルギーの差を図1 (b) に示す。undoped QDs においては130 K 以上で半値幅が減少している。これは熱エネルギーにより QD 間でよりエネルギー

の低い状態へのキャリア移動が生じ、大きな QD にキャリアが集中した事を示唆している。 対して Si-doped QDs では顕著な半値幅の変化 がない。また、温度上昇に伴い Si-doped QDs と undoped QDs の PL ピーク値の差が小さくなる ことから、Siをドープすると QD のフェルミ準 位が上昇してパウリブロッキング効果が生じ、 大きな QD へのキャリアの面内移動が抑制され たと考えられる。続いて、undoped QDs でキャ リアが熱活性による面内移動を明瞭に示す200 Kで時間分解PL測定を行った。図2の実線はPL スペクトルを示す。また黒点は単一指数関数の フィッティングにより求めた各検出エネルギ ーでのPL 寿命を示す。高エネルギー側の高速 な励起準位からの発光を除いて、Si ドーピング により相対的に PL 寿命の検出エネルギー依存 性が小さくなっており、チャージした量子ドッ トによるキャリアの面内移動のブロッキング 効果が現れている。 [1] T. Inoue et al., J. Appl. Phys. 108, 063524 (2010). [2] T. Kita et al., J. Appl. Phys. 110, 103511 (2011).[3] R. Hasegawa, et al., PVSEC (2011) and MBE conference (2012).





